

第3回 安井寛治(長岡科学技術大学)

日 時： 2006年6月23日(金)、24日(土)

場 所： 長岡技術科学大学マルチメディアシステムセンター

1日目午前 9:10~12:25

★チュートリアルセッション：「Cat-CVD法でわかったこと、わからないこと、
成し遂げたこと、成すべきこと」

司会：伊藤貴司(岐阜大) (各35分)

講師：松村英樹「Cat-CVD法の基礎的理解—Cat-CVDチェンバーの中で起きている現象—」

梅本宏信「気相過程における微量活性種検出の原理と実際」

越 光男「シリコン Cat-CVD プロセスの反応素過程」

10:55~11:15 Coffee Break

司会：牛島 満(東京エレクトロン) (各35分)

講師：小長井誠「Cat-CVD法のシリコンバルクならびに薄膜太陽電池への適用—特質と課題」

中山 弘「有機・無機ハイブリッド薄膜材料の開発と有機 Cat-CVD」

12:25~13:30 昼休み

1日目午後 13:30~ 40分×2

★オープニングセッション：キーノートトーク 司会：荻田陽一郎(神奈川工大)

松村英樹(北陸先端大)「Cat-CVD法が広い分野の基幹技術となる日」

高田雅介(長岡技大)「長岡技科大 21世紀 COE の紹介と触媒反応による ZnO の成長」

14:50~ 25分×2+一般講演 15分=1時間 05分

★セッション名：ラジカル処理 司会：清水耕作(日大)

和泉 亮(九州工大)「加熱触媒により生成した活性種を用いた金属の表面クリーニング」

西山岩男(ASET)「EUV露光装置用多層膜ミラーの水素クリーニング」

一般：高田、三浦、弓場(阪大)「熱触媒生成水素ラジカルによるイオン注入レジスト」

15:55~16:15 Coffee Break

16:15~ 25分×2+一般講演 15分×2=1時間 20分

★セッション名：薄膜・デバイスプロセス 司会：田畑彰守(名古屋大)

宮島晋介(東工大)「Cat-CVDを用いて作製したヘテロジャンクション結晶 Si 太陽電池」

松本和彦(大阪大)「Cat-CVD SiN 膜のカーボンナノチューブデバイスへの応用」

一般：阿部、長坂、上村(信州大)「ハロゲン系ガスを用いた HW-CVD 方による SiC 薄膜の製作と評価」

一般：中村、須佐、越(東大)「シリコン CVD プロセス中間体の紫外-可視吸収スペクトル」

17:35~

★セッション名：特別講演 司会：上村喜一(信州大) 40分

篠原久典(名古屋大)「2層カーボンナノチューブの成長と電子デバイス応用」

18:15 講演終了

19:00 バンケット (18:20 頃会場からバスが出ます) ==> 長岡グランドホテル

=====

2日目午前

9:00~ 25分×4=1時間40分

★セッション名：長岡技術科学大学の触媒科学研究 司会：弓場愛彦（阪大）

村上能規（長岡技大）「光触媒の反応機構」

西山 洋（長岡技大）「弾性表面波による格子変位効果を用いた金属薄膜表面の吸着・触媒作用の制御」

安井寛治（長岡技大）「低温活性触媒を用いた窒化物半導体の成長」

伊藤治彦（長岡技大）「アモルファス窒化炭素形成のための CVD 気相物理化学」

10:40~11:00 Coffee Break

11:00~ 25分×3=1時間15分

★セッション名：新応用 司会：齊藤公彦（三井化学）

大平圭介（北陸先端大）「Cat-CVD 法による有機薄膜の作製」

部家 彰（兵庫県立大）「ロールツウロール型 Cat-CVD 装置によるプラスチック上への SiNx 膜の連続形成」

武山真弓（北見工大）「Si-UlSI 技術における Cu 配線の拡散バリアへの Cat の応用例」

12:15~

★セッション名：特別講演 司会：赤坂洋一（大阪大）40分

霜垣幸浩（東大）「ULSI 多層配線形成用 CVD プロセス」

12:55~13:50 昼休み

2日目午後

13:50~

★セッション名：LSI 応用 司会：安井寛治（長岡技大）25分×3=1時間15分

高木（北添）牧子（アルバック）「Cat-CVD 法による SiN 膜の水素添加効果の検証」

戸塚正裕（三菱電機）「Cat-CVD 法により保護膜形成した C 帯 100W 超級 AlGaIn/GaN HEMT」

東脇正高（情通研機構）「Cat-CVD SiN 膜を用いたミリ波帯 GaN トランジスタの研究開発」

15:15~ Coffee Break も兼ねる

★セッション名：ポスターセッション 1時間30分（会場隣りの第三食堂）

16:50~

★セッション名：パネルディスカッション

「いかに実用化を加速するかー学界の貢献と国プロの役割、産業界からの要望」1時間

間

司会：増田 淳（産総研）

パネラー：浅利 伸（アルバック）、有門経敏（東京エレクトロン）、桑江良昇（東芝 セミコンダクター、宇都宮大学）、戸塚正裕（三菱電機）、中山弘（マテリアルデザインファクトリー）、松村英樹（北陸先端大）、南川俊治（石川県庁）、

17:50～

★Closing Remarks : 10分、7分、3分=20分

増田 淳（産総研）「第3回 Cat-CVD 研究会のまとめ」

野々村修一（岐阜大）「第4回ホットワイヤCVD（Cat-CVD）プロセス国際会議の案内」

第4回研究会実行委員長「第4回 Cat-CVD 研究会の案内」

18:10 終了